

FPD 用大型基板洗浄装置

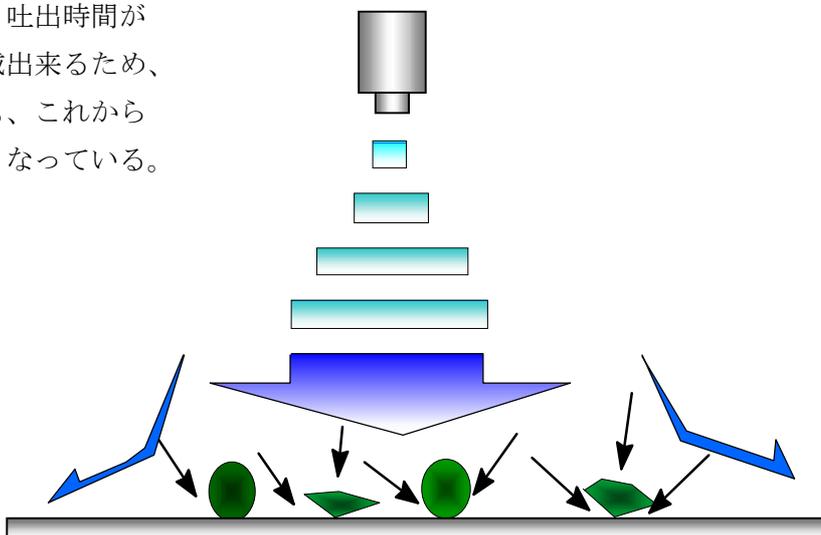
【応募内容】

従来型の連続吐出の場合は、ワーク表面に吐出された液が水膜となってしまいうため、その水膜により、直進性が阻害され、圧力エネルギーが干渉(吸収)されてしまい洗浄(除去)効率が落ちてしまう。また、一方方向の応力により、ワークへのダメージが甚大である。

そこで、パルスを使用する事により、水膜除去をしながら、ダイレクトにパーティクルに当てる事ができ、また応力を定期的に逃がしているため、ワークへの負担も少なくなる。

このパルス洗浄の特徴としては、吐出パルスをON/OFF制御（数十mm/secにて制御可能）をすることにより、スプレーパターンを複合的に変化させ、霧の方向性と力のモーメントが変動し、パーティクル除去に大きな役割を持たす事ができ、パルスと洗浄圧力との併用により、従来にない強力な洗浄(除去)が可能となっている。

また、パルスを発生させる事により、吐出時間が半分となり、液の使用量も大幅に削減出来るため、ランニングコストやエコロジー的にも、これからの時代のニーズに適合したシステムとなっている。



【企業概要】

代表取締役：小林 芳樹

本社所在地：〒358-0035 埼玉県入間市中神 508-2

業務内容：液晶製造装置、半導体製造装置の開発、販売

事業所：長野事業所(長野県諏訪市) 四国事業所(愛媛県東温市)

資本金：1億9,000万円

沿革：創業平成7年(業歴創業10年)

主な販売・受注先：SAMSUNG ELECTRONICS・BOE HYDIS TECHNOLOGY・CHI MEI OPTOELECTRONICS
シャープ(株)・信越半導体(株)・大日本印刷(株)・凸版印刷(株)・日本電気硝子(株)

従業員数：正社員30名

【連絡先】

担当者：小林 寛芳

所属：管理部

電話：04-2936-5062

FAX：04-2936-5064

E-mail：h.kobayashi@xevios.com